

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-132786

(43) Date of publication of application: 22.05.1998

(51)Int.CI.

G01N 27/62 H01J 49/26

(21)Application number : 08-305935

(71)Applicant: SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

30.10.1996

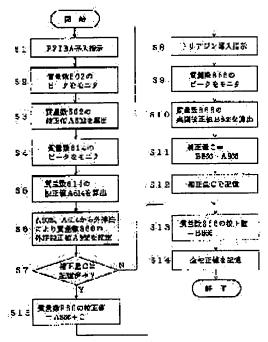
(72)Inventor: ITOI HIROTO

(54) MASS SPECTROSCOPE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To correctly calibrate mass number without using a standard sample of high molecular weight.

SOLUTION: Calibration values of two points obtained by actually measuring a standard sample of low molecular weight are extrapolated, thereby obtaining an extrapolation calibration value of a high mass number area (S6). The difference of a calibration value obtained by actually measuring a standard sample of high molecular weight and the extrapolation calibration value is stored as a correction amount in a memory (S12). In forming calibration values afterwards, only the standard sample of low molecular weight is measured, and the obtained calibration values of two points are



extrapolated, thereby obtaining the extrapolation calibration value of the high mass number area. The correction amount is added to the extrapolation calibration value, thereby, calculating the calibration value in the high mass number area (S15).

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平10-132786

(43)公開日 平成10年(1998)5月22日

(51) Int.CL ⁶	織別配号	ΡΙ	
G01N 27/62		GOIN 27/62	D
FIO 1 J 49/26		HO1J 49/26	

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 5 頁)

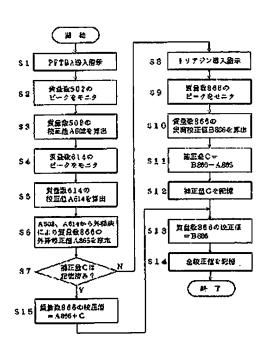
(21)出顯番号	特顯平8-305935	(71)出職人	000001993 株式会社島本製作所
(22)出願日	平成8年(1996)10月30日		京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地
		(72)発明者 糸井 弘人 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会 社島連製作所三条工場内	
		(74)代理人	弁理士 小林 奥平

(54) 【発明の名称】 質量分析装置

(57)【要約】

【課題】 高分子置の標準試料を使用せずに正確な質量 数の校正を行なう。

【解決手段】 低分子量の標準試料の実測により得た2点の校正値を外挿して高質量数領域の外挿校正値を求め (S6)、高分子量の標準試料の実測により得た校正値と外挿校正値との差を補正量としてメモリに記憶する (S12)。以降の校正値作成の際には、低分子量の標準試料の測定のみを行ない。これにより得た2点の校正値を外挿して高質量数領域の外挿校正値を求め、この外挿校正値に領正量を加算することにより高質量数領域における校正値を算出する(S15)。



待開平10-132786

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 標準試料の測定により得たピークを基に 算出した質量数の校正値を用いて未知試料のピークの質 置数を校正する質量分析装置において、

1

a)予め低分子量の標準試料及び高分子量の標準試料の測 定をそれぞれ実行し、該低分子量の標準試料の測定によ り得られた校正値を基に推定した高質量数領域における 校正値と該高分子量の標準試料の測定により得られた校 正値との差分に基づいて高質量数領域における校正値の **衛正量を求める補正置算出手段と、**

b)該補正置を記憶しておく記憶手段と、

ご低分子量の標準試料の測定により低質量数領域におけ る校正値を決定すると共に、該校正値と前記記憶手段に 記憶している補正置とに基づいて高質量数領域における 校正値を算出する校正値決定手段と

の該校正値決定手段により決められた校正値を用いて未 知試料のピークの質量数を校正する校正手段と、

を備えることを特徴とする質量分析装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は質量分析装置に関す る.

[0002]

【従来の技術】質量分析装置は、気化した試料分子をイ オン化し、このイオンを質量数(質量mを電荷でで除し た値)の大きさに応じて分離し、質量数毎にイオンの生 成骸に対応した強度信号を測定して質量スペクトルを作 成する構成を有している。この種の装置では、質量スペ クトルにおいて分子イオンのピークの現われる質量数か ら試料分子の分子量を算出することができる。また、分 30 子イオンが開設することにより生じるフラグメントイオ ンの各ピークを調べることにより開裂様式を推定し、こ れにより未知物質の構造を解析することができる。

【0003】とのような質量分析装置では、未知物質の 測定により得られる各ピークの正確な質量数は、分子量 が既知である標準試料によるピークを用いて決定され る。すなわち、図4に示すように、或る物質の分子量か **ち理論的に計算されるピークの位置(質量数)とその物** 質を測定したときにピークの現われる位置とは必ずしも 一致しない。そこで、標準試料を測定したときにピーク 40 ふ予め低分子室の標準試料及び高分子室の標準試料の測 の出現する位置とそのピークの理論値との差分を計算 し、これを校正値として記憶しておく。通常、このよう な校正値は質量数に依存するので、複数の質量数校正点 を設定し、各点における校正値をそれぞれ得て、その校 正値を内持又は外持することにより質量数校正点以外の 任意の質量数における校正値を求める。そして、未知試 料の測定により得たピークの実測値にその校正値を加算 することにより、未知試料の正確な質量数を算出する。 図4に示したような質量数のズレは装置の調整状況や気 温等の国団条件の影響を受けるため、例えば1日に1

回。或いは所定回数の未知試料の測定を実行する毎に標 進試料の測定を行なって校正値を修正するのが一般的で ある.

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の如き質量數校正 のために用いる標準試料はフラグメントイオンのピーク が規則的に現われるものが便利であり、例えば相対的に 低い質量数領域においてはPFTBA(Perfluorotribu tylamine) がよく用いられる。一方、質量数m/z=7 (0)程度以上の钼対的に高い質量数領域では、トリアジ ン (Tris-(perfluoroheptyl)-s-tmazine) やPKF (P erfluorokerosene)等の高分子量の標準試料が使用され る。しかしながら、PFTBAは滯点が低く気体として 安定であるため装置への導入が容易であるのに対し、ト リアジンやPKFは綿点が高く気体として不安定である ため、装置に導入するのが困難である。しかも、導入さ れた後にイオン化室内等に暫時残留するため、その後に 行なう未知試料の測定に影響を与えてしまい高感度の分 析に支障をきたすことがある。

【①①05】とのため、従来、PFTBA等の低分子置 (ととではトリアジン等と比較して低い分子費であると いう意味で「低分子置」という)の標準試料を用いて質 置数の/2=700以下の質量数領域内の複数の質量数 校正点における校正値を算出し、その校正値を外揮する ことにより質量数m/2=700以上の質量数領域にお ける校正値を求めるという簡易的な方法も利用されてい た。しかしながら、このような方法によると、大きな質 置数領域では校正の誤差が大きくなってしまうので高精 度の分析は行なえない。

【①①06】本発明は上記課題を解決するために成され たものであり その目的とするところは、高分子室の標 進試料による残留汚染をできる限り少なくしつつ。広い 質量数領域において精度の高い質量数校正を行なうこと ができる質量分析装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に成された本発明は、標準試料の測定により得たビーク を基に算出した質量数の校正値を用いて未知試料のピー クの智量数を校正する質量分析装置において、

定をそれぞれ実行し、該低分子量の標準試料の測定によ り得られた校正値を基に推定した高質量数領域における 校正値と該高分子畳の標準試料の測定により得られた校 正値との差分に基づいて高智量数領域における校正値の 箱正量を求める補正置算出手段と、

b)該補正置を記憶しておく記憶手段と、

ご低分子費の標準試料の測定により低質量数領域におけ る校正値を決定すると共に、該校正値と前記記憶手段に 記憶している補正置とに基づいて高質量数領域における 50 校正値を算出する校正値決定手段と.

(3)

の該校正値決定手段により決められた校正値を用いて未 知識料のピークの質量数を校正する校正手段と、を備え ることを特徴としている。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明に係る質量分析装置では、 予め、PFTBA等の低分子量の標準試料の測定を行な うことにより所定の質量数以下の領域内の複数の質量数 校正点における校正値を求める。また、トリアジン等の 高分子量の標準試料の測定を行なうことにより所定の質 正値を求める。補正置算出手段は、高分子置の標準試料 の測定により得た校正値と、低分子量の標準試料の測定 により得た2箇所以上の質量数校正点における校正値を 外挿して求めた外挿校正値との差分を計算し、この値を 校正値の絹正量として記憶手段に記憶させる。

【①①①9】一旦、浦正量が決定された後に校正値を修 正する処理を行なう際には、低分子量の標準試料のみを 使用し、この標準試料の測定を行なうことにより所定の 質量数以下の領域内の複数の質量数校正点における校正 数校正点における校正値を外挿して補正置に対応する質 置数校正点における外挿校正値を算出し、この外挿校正 値に補正置を加算(又は減算)することにより所定の質 置数以上の領域内の質量数校正点における校正値を算出 する。これにより、広い質量数範囲における校正値を得 て、この校正値を用いて未知試料の測定により得られた ピークの質量数を校正する。

[0010]

【発明の効果】本発明の質量分析装置によれば、始めに 高分子量の標準試料の測定を行なっておくことにより、 それ以降に校正値を修正する際には低分子置の標準試料 の測定のみにより広い質量数範囲に亘って正確な校正値 を得ることができる。実用上は、低分子量の標準試料の 測定により得られた校正値がそれ以前の値と大きく相違 する場合等、装置の設定条件が大きく変わったと想定さ れる場合にのみ、高分子量の標準試料の測定を再度行な い補正置を計算し直せばよい。したがって、取り扱いの 困難な高分子堂の標準試料を用いる必要が殆どなくなる ので、高分子量の標準試料による装置の残留汚染の恐れ が極めて小さくなると共に、測定者の作業の負担も軽減 40 される。また、高分子量の標準試料の測定を行なわずと も、高質量数領域を含む広い範囲において高精度の校正 が行なえ、分析精度が向上する。

[0011]

【実施例】以下、本発明に係る質量分析装置の一実施例 を図1~図3を参照して説明する。図1はこの質量分析 装置の構成図である。測定部は、イオン化部10.質量 分離部20、検出部22及び制御部24から構成され、 検出部22の検出信号はデータ処理部26に入力されて いる。イオン化部10のイオン化室12には、低分子置 50

の標準試料であるPFTBA及び高分子費の標準試料で あるトリアジンがそれぞれ電磁弁14、16を介して供 給されるようになっている。また、イオン化室12には 未知試料を導入するための試料導入管18も接続される よろになっており、例えばガスクロマトグラフ質量分析 装置(GC-MS)の場合には試料導入管18にはカラ ムから溶出するガスが導入される。

【0012】データ処理部26は、質量スペクトルを作 成すると共に質量スペクトルを基に各種演算処理を実行 置数以上の領域内の1箇所以上の質量数校正点おける校 10 することにより未知試料の分子置等を算出する。算出さ れた質量スペクトル及び分析結果は、プリンタ等の出力 部28から出力される。データ処理部26は校正処理部 30を含んでおり、校正処理部30は校正制御部32、 演算部34、補正量メモリ36及び校正値メモリ38等 から構成されている。

【① 0 1 3 】上記權成の質量分析装置における試料分析 時の動作を概略的に説明する。イオン化部10において 電磁弁14、16が閉鎖され、試料導入管18に気化し た試料が導入されると、イオン化室12内では電子衝撃 値を求める。校正値決定手段は、その2箇所以上の質量 20 により試料分子がイオン化され、更に分子イオンは開製 を生じフラグメントイオンを生成する。これらのイオン は質量分離部20において質量数に従って分離され、検 出部22では質量数毎にイオン生成数に応じたイオン電 後が得られる。質量分離部20に例えば四重極フィルタ を用いる場合には、四重極にED加する電圧を掃引するこ とにより四重極を通過するイオンの質量数を走査する。 また。磁気収束型の質量分解を行なう場合には、磁場を 掃引することによりイオンの軌道を変えて質量数を定査 する.

> 30 【①①14】データ処理部26では、このような質量を 査によって得られた検出信号を基に質量スペクトルが作 成される。質量分離部20において或る特定の質量数を 有するイオンを分離すべく制御したとき、実際に負出部 22にて検出されるイオンの質量数は一般に目的とする 質量数とは同一にならない。そこで、校正処理部30は この智量数のズレを校正し、質量スペクトルに現われた ピークの位置が理論的に正しい位置に近づくようにす る。以下、本実施例の質量分析装置の特徴的な動作であ る校正処理の動作を説明する。

【()() 15】未知試料の測定により得られたピークの質 置数の校正を行なうためには、予め1乃至複数の質量数 校正点における校正値を標準試料の測定により求めてお く。図2は、このような校正値を得るときの校正処理部 30の動作を示すフローチャートである。ここでは、例 えばPFTBAによる質量数校正点は質量数m/2=3 1. m/z = 69, m/z = 169. m/z = 264, m/z = 414. m/z = 502及びm/z = 614の 7箇所とし、トリアジンによる質量数校正点は質量数m /2=866の1箇所のみとする。

- 【0016】まず、初めて校正値を作成するか、或いは

既に校正値が作成されていても後述の補正置C自体を修 正する場合の処理動作について述べる。校正値作成が指 示されると、校正制御部32は制御部24に制御信号を 送り、電磁弁14を関いてPFTBAをイオン化室12 へ導入し前述のような測定を実行する(ステップS 1)。これにより、データ処理部26ではPFTBAの 質量スペクトルが作成される。PFTBAの質量スペク トルには上記?箇所の質量数校正点を含む複数の質量数 においてピークが現われるが、ここでは質量数m/2= 502及びm/2=614の2箇所の質量数校正点を高 10 質量数領域における校正値を推定するために利用するも のとする。

【①①17】そこで、PFTBAの質量スペクトルから 質量数m/2=502に対応するピークをモニタし(ス テップS2)、このピークの質量数の実測値と理論値と の差分を求め、これを質量数m/2=502における校 正値A502とする(ステップS3)。次に、PFTBA の質量スペクトルから質量数面/2=614に対応する ピークをモニタし(ステップS4)。このピークの質量 2=614における校正値A614とする(ステップS 5)。そして図3に示すように、校正値A 502及び校正 値A 514の2点を外挿することにより、質量数m/2= 866における外挿校正値A866を推定する(ステップ S6)。すなわち、外挿校正値A866は次式により得ら れる。A 866= ((A 614-A 502) · (866-61 4) / (614 - 502)] + A614

【①①18】続いて、絹正量Cが絹正量メモリ36に記 健されているか否かを判定する(ステップS7)。初め て校正値作成処理を行なう場合には補正置Cは記憶され 30 ていないからステップS8へと造む。また、絹正量C自 体の修正を行なう場合にも予め縞正量をリセットする等 の処理を行なうことによりステップS8へと進むように

【①019】ステップS8では、校正制御部32は制御 部24に制御信号を送り、電磁弁16を開いてトリアジ ンをイオン化室12へ導入し前述のような測定を実行す る(ステップS8)。これにより、データ処理部26で はトリアジンの質量スペクトルが作成される。この質量 をモニタし(ステップS9)、このピークの質量数の実 測値と理論値との差分を求め、これを質量数m/z=8 66における実測校正値B866とする(ステップS1 (i)。そして、この実測校正値B866と先に算出した外 挿校正値A855との差分を計算し(ステップS11). この差分を絹正量Cとして補正置メモリ36に記憶する **(ステップS12)。**

【①①20】続いて、上記実測校正値B866を質量数m /2=866の質量数校正点における校正値とし(ステ ップS13) 他の7箇所の質量数校正点における校正 50 【図3】 この質量分析装置における校正値作成処理の

値はPFTBAの実測に基づく校正値を用い、これらの 計8箇所の質量教校正点における校正値を校正値メモリ 38に記憶する(ステップS14)。以上により校正値 作成処理が終了する。したがって、このような処理の後 に未知試料の分析を実行する場合、上述のように校正値 メモリ38に記憶された校正値を用い、質量数校正点以 外の質量数に対してはその質量数に近接した2箇所の質 置数校正点における校正値を内挿又は外挿して校正値を 算出する。そして、未知試料の測定により得られたビー クの質量数に算出した校正値を加算することにより、正 確な質量数を算出する。

【①①21】上途のように、一旦箱正量Cが記憶された 後に校正値作成処理が実行される場合には、PFTBA の測定を行なった後に上記ステップS?にて浦正量Cが 記憶されていると判定されるのでステップS15へ進 む。とこでは、PFTBAの測定に基づいて推定された 外挿校正値A865に補正置メモリ36から読み出した補 正量Cを加算し、これを質量数加/2=866の質量数 校正点における校正値とする。したがって、浦正量Cが 数の実測値と理論値との差分を求め、これを質量数m/ 20 記憶されているときには、トリアジンを用いることなく PFTBAの測定結果及び補正量Cに基づいて質量数m /2=866の質量数校正点における校正値が決定され

> 【①①22】なお上記実施例では、低分子置の標準試料 としてPFTBA、高分子量の標準試料としてトリアジ ンを使用しているが、他の標準試料を使用してもよい。 【0023】また、図1の構成ではトリアジンを電磁弁 16を介してイオン化室12に導入するようにしている が、トリアジンを使用する頻度は極めて低いため、PF 丁BAのみを電磁弁を介して導入するようにし、トリア ジンは必要に応じてマニュアル操作により導入するよう な構成とすれば装置のコストを下げることができる。こ の場合、トリアジンは手動弁を設けた試料導入管を介し て導入するようにしてもよいし、また未知試料を導入す るための試料導入管を利用するようにしてもよい。 【0024】更には、上記実施例において、トリアジン

の測定による質量数校正点を複数(例えば質量数m/2 =771、m/z=866, m/z=1016の3箇 所)とし、各質量数校正点において上述の方法で補正置 スペクトルから賀置数m/2=866に対応するビーク 40 を算出するようにしてもよい。また、外挿方法は2点間 の直線外挿のみならず、3点以上を用いた適宜の関数に よる外挿とすることもできる。

> 【①025】その他の点においても、上記真施例は一例 であって本発明の趣旨の範囲で適宜変更や修正を行なえ ることは明らかである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の質量分析装置の一実施例の構成図。

【図2】 この質量分析装置における校正値作成処理の 動作を示すフローチャート。

